



**DIPARTIMENTO DI
FISICA E. Fermi**

Largo Pontecorvo, 3
I-56127 Pisa, Italy

Francesco Fuso

Tel. +39 0502214305, 293, 291
Fax +39 0502214333
fuso@df.unipi.it
<http://www.df.unipi.it/~fuso/>

Pisa, 3/10/2009

Corso di Laurea Specialistica in Scienza dei Materiali

Fisica delle nanotecnologie

(3 cfu, FIS/03)

Programma di massima del corso a.a. 2009/2010

Introduzione, generalità e alcuni richiami: definizioni, motivazioni e concetti fondamentali; l'ambito della micro- e nanoelettronica: richiami sugli aspetti di base dell'elettronica convenzionale: trasporto diffusivo e comportamento dei film sottili; semiconduttori inorganici e loro drogaggio; giunzioni con semiconduttori, transistor bipolare; tecnologie "planari" e principi di funzionamento del MOS-FET; il futuro della "legge di Moore" ed alcuni problemi connessi con la miniaturizzazione.

Tecnologie per la fabbricazione di film sottili: crescita epitassiale ed eteroepitassiale ed aspetti microstrutturali; alcuni limiti di miniaturizzazione; principali metodi fisici e chimici per la deposizione di film sottili: MBE, MO-MBE, cenni su sputtering, PLAD, PE-CVD, LPE, deposizione da fase liquida e sol-gel.

Tecnologie per l'osservazione e la definizione per via ottica di nanostrutture: approcci top-down convenzionali: litografia ottica, cenni di tecnologia del resist e dell'etching, lift-off; richiami sulla diffrazione ottica, risoluzione spaziale e limite di Abbe; microscopia ottica convenzionale, microscopia confocale; strategie per l'aumento della risoluzione spaziale nella litografia ottica: off-axis illumination, cenni su etching anisotropo, side-wall patterning e litografia a multi fotone, maschere a contrasto di fase; manipolazione laser di atomi neutri e litografia atomica come esempio di tecnica bottoms-up: forza dipolare e cenni di raffreddamento laser; tecniche emergenti di nanoimprinting per materiali soft.

Tecnologie per l'osservazione e la definizione di nanostrutture mediante fasci di cariche: microscopia elettronica SEM e TEM: funzionamento e principali meccanismi di contrasto in trasmissione e in riflessione, campo chiaro e campo scuro, microanalisi; litografia elettronica e con fasci ionici: tecniche EBL a scansione, SCALPEL e FIB; vantaggi e limiti connessi con la litografia a fascio di cariche.

Tecnologie per l'analisi e la manipolazione di nanoparticelle mediante microscopia a scansione di sonda: generalità sulla SPM: modi di operazione, artefatti, risoluzione spaziale; richiami sull'effetto tunnel e principali modelli interpretativi dell'STM (modello giunzione MIM o di Simmons, modello di Bardeen/Tersoff-Hamann, densità degli stati superficiali), risoluzione spaziale verticale e laterale; interpretazione delle curve I-V ed I-Z (spettroscopia); interazione meccanica tra atomi e superfici: cenni al modello di Hertz, all'adesione superficiale, alle forze di Van der Waals; funzionamento dell'AFM/SFFM; modalità di operazione in contatto, non-contatto, contatto intermittente e contrasto di fase per la misura della viscoelasticità superficiale; esempi di altre microscopie a scansione di forza verticale e laterale; campo ottico prossimo: interpretazione in termini di ottica di Fourier, relazione con il principio di indeterminazione, modello di Bethe-Bouwkamp; microscopia a campo prossimo ottico (SNOM) e sue applicazioni principali; esempi di nanomanipolazione e nanolitografia mediante SPM: nanomanipolazione verticale e laterale, litografia STM, nanoscrittura per intrappolamento di carica in ossidi, nanoindentazione e nanoscratching; cenni sulla nanoscrittura ottica e sui materiali fotoattivi.

Proprietà ottiche in sistemi e dispositivi a bassa dimensionalità: densità degli stati e dimensionalità dei sistemi; proprietà ottiche di sistemi confinati a base di semiconduttori (MQW e quantum dots): eccitoni; richiami sui laser ad



**DIPARTIMENTO DI
FISICA E. Fermi**

Largo Pontecorvo, 3
I-56127 Pisa, Italy

Francesco Fuso

Tel. +39 0502214305, 293, 291
Fax +39 0502214333
fuso@df.unipi.it
<http://www.df.unipi.it/~fuso/>

Pisa, 3/10/2009

eterogiunzione e sulla loro tecnologia; aspetti fondamentali di alcuni laser “nanotecnologici” (a quantum dot, a cavità verticale, a cascata quantica); fotoluminescenza da quantum dots e nanocristalli; richiami sui plasmoni di superficie e sulle risonanze plasmoniche in nanoparticelle metalliche; proprietà ottiche in campo prossimo e campo lontano di nanoparticelle metalliche e risonanze plasmoniche localizzate; esempi di nanofotonica (guide d’onda plasmoniche).

Proprietà di trasporto elettronico in sistemi e dispositivi a bassa dimensionalità: modulation doping e sistemi 2DEG all’interfaccia tra semiconduttori; effetto Hall quantistico; livelli di Landau, quanto di resistenza di von Klitzing; trasporto balistico in sistemi 2DEG; guide d’onda elettroniche e quantum wires; livelli di Landauer, modi trasversi; effetto tunnel da barriera doppia e diodi ad effetto tunnel risonante; fenomeni di singolo elettrone ed effetti di Coulomb-blockade e Coulomb staircase in sistemi 0DEG.

Nanostrutture isolate e materiali nanocompositi: nanostrutture di carbonio: cenni su fullereni e nanotubi; fabbricazione, morfologia, struttura, proprietà elettroniche e cenni sulle proprietà meccaniche di nanotubi di carbonio; esempi di dispositivi innovativi a base di nanotubi (CNT-FETs).

Esempi di sistemi nanotecnologici di natura organica: generalità ed introduzione su alcune tematiche nanotecnologiche basate sull’impiego di sistemi molecolari e macromolecolari; fabbricazione di film sottili di natura organica: monostrati autoassemblati (SAM) e loro impiego; fondamenti della conduzione in polimeri coniugati e ruolo del drogaggio; trasferimento di carica in molecole singole ed esempi di nanoelettronica intramolecolare (cavi, switches, diodi,...); alcune prospettive sulla fabbricazione e l’impiego di sistemi ibridi bio-molecolari: cenni sulla realizzazione di templates basati su DNA; dispositivi emettitori a base organica: architettura degli OLED multistrato, materiali e principali problematiche.]

Modalità di svolgimento dell’esame finale: l’esame si svolge normalmente sotto forma di una breve presentazione/seminario su un argomento di interesse per il corso da decidere in accordo con il docente.

Testi di riferimento: materiale didattico è disponibile sul sito del docente (<http://www.df.unipi.it/~fuso/dida>). Un elenco parziale dei testi di riferimento utilizzati comprende:

- P.Y. Yu, M. Cardona, *Fundamentals of semiconductors: physics and materials properties*, Springer Verlag (1999).
- F. Bassani, U.M. Grassano, *Fisica dello Stato Solido*, Bollati Boringhieri (2000).
- R. Waser (ed.), *Nanoelectronics and information technology*, Wiley-VCH (2003).
- B. Bushan (ed.), *Springer Handbook of nano-technology*, Springer (2004).
- P.N. Prasad, *Nanophotonics*, Wiley-Interscience (2004).
- M. Ohring, *The materials science of thin films*, Academic (1997).
- G. Timp, *Nanotechnology*, Springer-Verlag (1999).
- M.J. Madou, *Fundamentals of microfabrication*, CRC Press (1997).
- R. Wiesendanger, *Scanning Probe Microscopy: analytical methods (Nanoscience and Technology)*, Springer-Verlag (1998).
- C.P. Poole Jr and F. Owens, *Introduction to nanotechnology*, Wiley (2003).
- J.M. Tour, *Molecular Electronics*, World Scientific (2003).
- J.Y. Ying (ed.), *Nanostructured materials*, Academic Press (2001).
- D. Brandon and W.D. Kaplan, *Microstructural characterization of materials*, Wiley (1999).